06 Оптическое поглощение в эпитаксиальных кобальтсодержащих пленках гадолиний-галлиевого граната

© В.В. Рандошкин, Н.В. Васильева, В.Г. Плотниченко, Ю.Н. Пырков

Совместная хозрасчетная лаборатория "Магнитооптоэлектроника" Института общей физики РАН при Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева

Научный центр оптики при Институте общей физики РАН, Москва

Поступило в Редакцию 3 июля 2000 г.

Сообщается об обнаруженном оптическом поглощении двух- и трехвалентными ионами кобальта в монокристаллических пленках гадолиний-галлиевого граната, выращенных методом жидкофазной эпитаксиии из переохлажденных растворов-расплавов на основе PbO–B₂O₃ и PbO–B₂O₃–GeO₂.

Монокристаллы MgAl₂O₄, легированные ионами Co²⁺, могут использоваться в качестве насыщающегося фильтра в лазерах ближнего инфракрасного (ИК) диапазона [1]. Это обусловлено наличием в этих материалах широкой полосы поглощения в диапазоне длин волн $\lambda = 1.3 - 1.6 \,\mu$ m.

С целью выяснения возможности получения этого эффекта в монокристаллических пленках гадолиний-галлиевого граната, содержащих ионы кобальта, в настоящей работе методом жидкофазной эпитаксии из переохлажденного раствора-расплава синтезированы Со-содержащие пленки граната и изучено их оптическое поглощение. Пленки выращивали на подложках Gd₃Ga₅O₁₂ (ГГГ) с ориентацией (111) из раствороврасплавов на основе PbO–B₂O₃ (I) PbO–B₂O₃–GeO₂ (II). В первом случае для обеспечения зарядовой компенсации [2] кобальт в основном должен находиться в трехвалентном состоянии. Лишь небольшое количество ионов Co²⁺ может образовываться для компенсации заряда примесных ионов Pb⁴⁺ и Pt⁴⁺, входящих в пленку из раствора-расплава. Во втором случае ионы кобальта должны переходить в двухвалентное состояние для компенсации заряда ионов Ge⁴⁺, входящих в основном в тетраэдрическую подрешетку структуры граната.

55

Состав раствора-расплава I характеризовался следующими мольными отношениями:

$$R_1 = (Ga_2O_3 + Co_3O_4)/Gd_2O_3 \approx 14.42,$$

 $R_2 = PbO/B_2O_3 \approx 16.03,$

 $R_3 = (Gd_2O_3 + Ga_2O_3 + Co_3O_4) / (Gd_2O_3 + Ga_2O_3)$

$$+ \operatorname{Co}_3\operatorname{O}_4 + \operatorname{PbO} + \operatorname{B}_2\operatorname{O}_3) \approx 0.08$$

$$R_4 = \mathrm{Ga}_2\mathrm{O}_3/\mathrm{Co}_3\mathrm{O}_4 \approx 9.00,$$

а состав раствора-расплава II следующими:

$$\begin{split} R_1 &= (\mathrm{Ga}_2\mathrm{O}_3 + \mathrm{GeO}_2 + \mathrm{Co}_3\mathrm{O}_4)/\mathrm{Gd}_2\mathrm{O}_3 \approx 30.77, \\ R_2 &= \mathrm{PbO}/\mathrm{B}_2\mathrm{O}_3 \approx 16.03, \\ R_3 &= (\mathrm{Gd}_2\mathrm{O}_3 + \mathrm{Ga}_2\mathrm{O}_3 + \mathrm{GeO}_2 + \mathrm{Co}_3\mathrm{O}_4)/(\mathrm{Gd}_2\mathrm{O}_3 + \mathrm{Ga}_2\mathrm{O}_3 \\ &\quad + \mathrm{GeO}_2 + \mathrm{Co}_3\mathrm{O}_4 + \mathrm{PbO} + \mathrm{B}_2\mathrm{O}_3) \approx 0.15, \\ R_4 &= (\mathrm{Ga}_2\mathrm{O}_3 + \mathrm{GeO}_2)/\mathrm{Co}_3\mathrm{O}_4 \approx 20.35. \end{split}$$

Пленки, выращенные из раствора-расплава I, были окрашены в зеленый цвет, а из раствора-расплава II — в синий. Это свидетельствует о разной валентности ионов кобальта, входящих в их состав. Параметры роста пленок приведены в таблице, где T_g — температура роста, t_g — время роста, f_g — скорость роста. Здесь же для сравнения приведены данные для пленки, выращенной из раствора-расплава III на основе PbO–B₂O₃, не содержащего кобальта [3].

Толщину пленок *h* определяли, взвешивая подложку до эпитаксиального роста и пленку с подложкой после него [3,4]. Различием плотности пленки подложки, как и в работе [4], пренебрегали. Спектр пропускания пленок измеряли с помощью спектрофотометра Lambda 900 фирмы Perkin–Elmer.

На рисунке приведены спектры пропускания пленок, выращенных из растворов-расплавов I, II и III (кривые 1, 2, 3 соответственно), и подложки ГГГ (кривая 4). Видно, что образец 1 (см. таблицу) обладает широкой полосой поглощения в ИК диапазоне $\lambda = 0.9 \div 1.63 \,\mu\text{m}$ с центром на длине волны $\lambda = 1273 \,\text{nm}$ и относительно слабыми

Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 23



Спектры оптического пропускания $T(\lambda)$ эпитаксиальных пленок номинальных составов Gd₃(Ga, Co)₅O₁₂ (1), Gd₃(Ga, Ge, Co)₅O₁₂ (2) и Gd₃Ga₅O₁₂ (3) и подложки Gd₃Ga₅O₁₂ (4).

Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 23

№ образца	Раствор-расплав	T_g , °C	t_g , min	f_g , μ m/min	2h, µm
1	Ι	937	60	0.8	92.3
2	II	874	120	0.2	44.6
3	III	914	10	0.8	15.9

Параметры роста эпитаксиальных монокристаллических пленок

пиками поглощения с центрами на длинах волн $\lambda = 565, 626$ и 670 nm. Наличие этой полосы и пиков поглощения может быть связано только с ионами Co³⁺. Образец 2 (см. таблицу) обладает широкой полосой поглощения в диапазоне длин волн $\lambda = 1.2 \div 1.7 \,\mu$ m, слабыми пиками поглощения с центрами на длинах волн $\lambda = 573, 615$ и 658 nm, причем минимум поглощения имеет место на длине волны $\lambda = 504$ nm. Наличие этой широкой полосы поглощения, как и в работе [1], может быть связано с переходом иона Co²⁺ из основного состояния ⁴A₂(⁴F) на уровень ⁴T₁(⁴F). Коротковолновый край кривой пропускания пленки номинального состава Gd₃(Ga, Co)₅O₁₂ (кривая *1*) и пленки номинального состава Gd₃(Ga, Ge, Co)₅O₁₂ (кривая *2*) по сравнению с подложкой (кривая *4*) и пленкой номинального состава Gd₃Ga₅O₁₂ (кривая *3*) смещен в длинноволновую область.

Таким образом, в настоящей работе показано, что эпитаксиальные Со-содержащие монокристаллические пленки гадолиний-галлиевого граната обладают оптическим поглощением, необходимым для разработки на их основе насыщающихся фильтров ИК диапазона.

Авторы искренне благодарят А.В. Васильева, М.И. Беловолова, В.А. Михайлова за помощь в проведении настоящей работы и обсуждении ее результатов.

Список литературы

- [1] Галаган Б.И., Годовикова Е.А., Денкер Б.И., Мейльман М.Л., Осико В.В., Сверчков С.Е. // Квантовая электроника. 1999. Т. 26. № 3. С. 189–190.
- [2] Рандошкин В.В., Червоненкис А.Я. Прикладная магнитооптика. М.: Энергоатомиздат, 1990. 320 с.
- [3] Рандошкин В.В., Васильева Н.В., Савелецкий А.М., Сысоева Н.Н. // Письма в ЖТФ. 1999. Т. 25. В. 17. С. 18–22.
- [4] Рандошкин В.В., Беловолов А.М., Беловолов М.И., Васильева Н.В., Дианов Е.М., Сташун К.В., Тимошечкин М.И. // Квантовая электроника. 1998. Т. 25. В. 3. С. 233–235.

Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 23